(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2010 年 3 月 4 日(04.03.2010)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2010/024146 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/683 (2006.01) *H02N 13/00* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2009/064415

(22) 国際出願日: 2009 年 8 月 17 日(17.08.2009)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2008-218404 2008 年 8 月 27 日(27.08.2008) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社アルバック (ULVAC, INC.) [JP/JP]; 〒2538543 神奈川県茅ヶ崎市萩園２５００番地 Kanagawa (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 佐藤 正幸 (SATOU, Tadayuki) [JP/JP]; 〒4101231 静岡県裾野市須山１２２０－１４ 株式会社アルバック富士裾野工場内 Shizuoka (JP). 岡 正 (OKA, Tadashi) [JP/JP]; 〒4101231 静岡県裾野市須山１２２０－１４ 株式会社アルバック 富士裾野工場内 Shizuoka (JP). 中村 久三 (NAKAMURA, Kyuzo) [JP/JP]; 〒2538543 神奈川県茅ヶ崎市萩園２５００ 株式会社アルバック内 Kanagawa (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人青莪 (SEIGA Patent and Trademark Corporation); 〒1410031 東京都品川区西五反田８－１－１４ 最勝ビル９階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

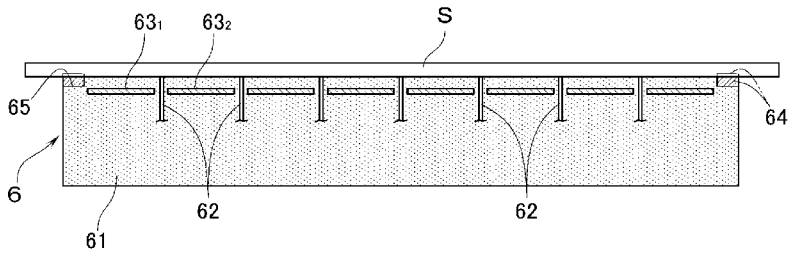
添付公開書類:

— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）

(54) **Title**: ELECTROSTATIC CHUCK AND VACUUM PROCESSING APPARATUS

(54) 発明の名称 : 静電チャック及び真空処理装置

[図2]



(57) **Abstract**: Provided is an electrostatic chuck which can surely hold a translucent substrate to be processed even when an attracting force is deteriorated due to photoelectric effects, at the time of performing processing, including light irradiation, to the substrate by making the electrostatic chuck hold the substrate. An electrostatic chuck (6) is provided with a chuck plate (61) composed of a dielectric material, and a first electrode (63_1) and a second electrode (63_2) arranged on the chuck plate (61), and a voltage is applied to between the first and the second electrodes (63_1, 63_2), and a substrate (S) to be processed is attracted to a surface of the chuck plate (61). On one part of the surface of the chuck plate (61), a substrate holding section (64) composed of an adhesive sheet or the like having an adhesive force to the substrate (S) is arranged.

(57) 要約: 静電チャックに透光性を有する処理基板を保持させて、処理基板に対し光の照射を伴う処理を施す際に、光電効果で吸着力が低下しても処理基板を確実に保持できるようにした静電チャックを提供する。 静電チャック（６）は、誘電体から成るチャックプレート（６１）と、チャックプレート（６１）に設けた第１電極（６３_1）と第２電極（６３_2）とを備え、第１と第２の両電極（６３_1，６３_2）間に電圧を印加して、処理基板（Ｓ）をチャックプレート（６１）の表面に吸着する。チャックプレート（６１）の表面の一部に、処理基板（Ｓ）に対する粘着力を有する粘着シート等から成る基板保持部（６４）が設けられる。

WO 2010/024146 A1